

財團法人國家實驗研究院晶片系統設計中心  
使用者名單

製程名稱(限填單一製程<各製程請分別製作>)：

**CIC 0.18um 1.8V/3.3V 1P6M Virtual Mixed Mode/RFCMOS Process**

填表日期： 年 月 日

1. 申請人僅授權以下人員使用經由 CIC 申請製程之相關製程資料，並負有監督被授權使用者保密之責任。被授權使用者應妥善保管相關製程資料並不得以任何方式複製、散佈製程資料，亦不得授權其他任何人使用製程資料。製程資料含紙本資料及電子檔資料。
2. 被授權使用者請附學生證正反面影本並有當學期註冊章，或其他可證明學生身分之文件。
3. 被授權使用者有新增時，則須繳交本名單。
4. 申請人依實際被授權使用者數複製製程資料給予被授權使用者使用，被授權使用者不得再複製。
5. 申請人如無被授權使用者，請在被授權使用者姓名欄位填寫「無」即可。
6. 被授權使用者名單逾期未交之申請者將無法再授權予學生使用，亦即學生無法下線製作晶片。直至確認被授權使用者名單已繳交且內容無異常現象，方可恢復其授權狀態。

<p>1.學生_____ (姓名) 身分證字號_____、 聯絡電話_____、Email：_____， 經本人授權使用 貴中心授權製程資料，保證於學生離開學校時(如：畢業，休學)，立即停止使用所有的製程資料，並自行銷毀所有的資料避免外洩。如有違反前述宣言而造成 貴中心或製程提供廠商的損失，同意負擔所有賠償責任及相關之法律責任。</p>	<p>.....浮貼學生證正反面(含當學期註冊章).....</p>
<p>1.學生_____ (姓名) 身分證字號_____、 聯絡電話_____、Email：_____， 經本人授權使用 貴中心授權製程資料，保證於學生離開學校時(如：畢業，休學)，立即停止使用所有的製程資料，並自行銷毀所有的資料避免外洩。如有違反前述宣言而造成 貴中心或製程提供廠商的損失，同意負擔所有賠償責任及相關之法律責任。</p>	<p>.....浮貼學生證正反面(含當學期註冊章).....</p>
<p>1.學生_____ (姓名) 身分證字號_____、 聯絡電話_____、Email：_____， 經本人授權使用 貴中心授權製程資料，保證於學生離開學校時(如：畢業，休學)，立即停止使用所有的製程資料，並自行銷毀所有的資料避免外洩。如有違反前述宣言而造成 貴中心或製程提供廠商的損失，同意負擔所有賠償責任及相關之法律責任。</p>	<p>.....浮貼學生證正反面(含當學期註冊章).....</p>

**授權教授所屬學校系所：國立清華大學電機工程學系**

**授權教授(簽章)：**

**【人數較多時，請自行複製，授權教授(即申請者)並於每頁最後簽章即可】**